

# 光刻板 苏州制版

产品名称	光刻板 苏州制版
公司名称	苏州微麦光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区星湖街328号崇文路国华大厦B418室
联系电话	17710798515

## 产品详情

### 什么是光刻掩模板

在薄膜、塑料或玻璃基体材料上制作各种功能图形并精确定位，以便用于光致抗蚀剂涂层选择性曝光的一种结构，称为光刻掩模板。

半导体集成电路制作过程通常需要经过多次光刻工艺，在半导体晶体表面的介质层上开凿各种掺杂窗口、电极接触孔或在导电层上刻蚀金属互连图形。光刻工艺需要一整套（几块多至十几块）相互间能精确套准的、具有特定几何图形的光复印掩蔽模版。

苏州制版位于苏州工业园区生物纳米园，是集研究、设计、生产、销售于一体，专业制作高精度掩膜版的企业，拥有高标准的全净化厂房，优秀的高素质人才、专业的研发团队。苏州制版，面向中小企业、大学、研究所客户，提供包括全系列精度和面积的铬版和菲林版！根据客户的构想、草图，独家定制版图提供技术咨询服务！

苏州制版提供包括全系列精度和面积的铬版和菲林版，光刻板，目前投入生产有多台激光直写设备以及电子束曝光设备。常规铬版CD精度 $\pm 0.2\mu\text{m}$ ，高精石英铬版精度 $\pm 0.07\mu\text{m}$ 。菲林版分辨率20 $\mu\text{m}$ 以上精度 $\pm 2\mu\text{m}$ 。曝光设备外，还拥有全自动显影柜，可以批量进行显影处理，保证生产能力。在图形检验阶段我们拥有自动光学检验机台（AOI），通过图形逻辑对比分析取样，修补能力1.2 $\mu\text{m}$ ，精度 $\pm 0.1\mu\text{m}$ 。可以有效地排除缺陷问题。

公司产品包括石英掩膜版，苏打掩膜版，以及菲林版。苏州制版根据客户的构想、草图，定制版图，苏州制版提供高质量掩膜版以及后期的代加工服务！

刻蚀或离子注入完成后，将进行光刻的最后一步，即将光刻胶去除，以方便进行半导体器件制造的其他步骤。通常，半导体器件制造整个过程中，会进行很多次光刻流程。生产复杂集成电路的工艺过程中可能需要进行多达50步光刻，而生产薄膜所需的光刻次数会少一些。

光刻板-苏州制版由苏州微麦光电有限公司提供。光刻板-苏州制版是苏州微麦光电有限公司（[www.szphotomask.com](http://www.szphotomask.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶佳。